

DIN 50455-1:2009-10 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken - Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit optischen Messverfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Kurzbeschreibung	4
4 Einheiten	4
5 Geräte und Materialien	5
6 Durchführung	5
6.1 Allgemeines	5
6.2 Probenherstellung	6
6.2.1 Umgebungsbedingungen	6
6.2.2 Herstellverfahren	6
6.3 Messung der Schichtdicke	6
7 Auswertung	7
7.1 Allgemeines	7
7.2 Absolutverfahren	7
7.3 Differenzverfahren	8
8 Präzision	8
9 Prüfbericht	8
Bilder	
Bild 1 — Beispiel eines Messstellenplanes	7